

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 28 年 3 月 31 日 (2016.3.31)

【公表番号】特表 2015-534279 (P2015-534279A)

【公表日】平成 27 年 11 月 26 日 (2015.11.26)

【年通号数】公開・登録公報 2015-074

【出願番号】特願 2015-537703 (P2015-537703)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/10 (2006.01)

H 0 5 K 3/34 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/10 C

H 0 5 K 3/34 5 0 5 B

【手続補正書】

【提出日】平成 28 年 2 月 5 日 (2016.2.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ウィスカー発生金属を含む表面における金属ウィスカー ( 1 5 ) の形成を低減する方法であって、

少なくとも 1 つの電磁エネルギー源から電磁エネルギーを出射させることによって、ウィスカー発生金属が配置された放射場を形成することと、

前記電磁エネルギーの前記出射に関連したパラメータを制御すること、とを含み、前記パラメータは、電磁エネルギーの周波数、振幅、出力レベル、及び、前記出射の期間を含む、方法。

【請求項 2】

電磁エネルギーを出射するためのパラメータを制御することは、連続的に電磁エネルギーを出射するように、前記少なくとも 1 つの電磁エネルギー源を制御することをさらに含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

電磁エネルギーを出射するためのパラメータを制御することは、周期的なスケジュールに従って電磁エネルギーを出射するように、前記少なくとも 1 つの電磁エネルギー源を制御することをさらに含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

電磁エネルギーを出射するためのパラメータを制御することは、約 1 ワットのテラヘルツ出力の電磁エネルギーを出射するように、前記少なくとも 1 つの電磁エネルギー源を制御することをさらに含む、請求項 1 のいずれかに記載の方法。

【請求項 5】

電磁エネルギーを出射するためのパラメータを制御することは、単一の周波数で電磁エネルギーを出射するように、前記少なくとも 1 つの電磁エネルギー源を制御することをさらに含む、請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の方法。

【請求項 6】

電磁エネルギーを出射するためのパラメータを制御することは、一組の異なる周波数で電磁エネルギーを出射するように、前記少なくとも 1 つの電磁エネルギー源を制御するこ

とをさらに含む、請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の方法。

【請求項 7】

ハウジング ( 3 2 ) に電磁エネルギーを印加するための装置であって、前記装置は、  
ウィスカー発生金属を含む電子部品 ( 2 7 ) を収容する前記ハウジング ( 3 2 ) に電磁エネルギーを与えるように配置された少なくとも 1 つの電磁エネルギー源と、

前記少なくとも 1 つの電磁エネルギー源からの電磁エネルギーの出射を制御するための  
コントローラー ( 5 5 ) とを含み、前記出射は、前記電磁エネルギーの周波数、振幅、出  
力レベル、及び、前記出射の期間を含むパラメータに基づく、装置。

【請求項 8】

前記少なくとも 1 つの電磁エネルギー源は、テラヘルツエミッター ( 3 5 ) である、請  
求項 7 に記載の装置。

【請求項 9】

前記テラヘルツエミッター ( 3 5 ) は、ホーン型アンテナ ( 4 0 ) を含む、請求項 8 に  
記載の装置。

【請求項 10】

前記テラヘルツエミッター ( 3 5 ) は、量子カスケードレーザー ( 4 5 ) を含む、請求  
項 8 又は 9 に記載の装置。

【請求項 11】

前記テラヘルツエミッター ( 3 5 ) は、クーラー ( 5 0 ) を含む、請求項 8 ~ 10 のい  
ずれかに記載の装置。